

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成28年5月19日 (2016.5.19)

【公開番号】特開2013-166931(P2013-166931A)

【公開日】平成25年8月29日 (2013.8.29)

【年通号数】公開・登録公報2013-046

【出願番号】特願2013-15055(P2013-15055)

【国際特許分類】

C 0 8 F 220/24 (2006.01)

G 0 3 F 7/039 (2006.01)

G 0 3 F 7/004 (2006.01)

C 0 8 F 8/12 (2006.01)

C 0 8 F 8/50 (2006.01)

C 0 8 F 2/48 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 F 220/24

G 0 3 F 7/039 6 0 1

G 0 3 F 7/004 5 0 3 A

C 0 8 F 8/12

C 0 8 F 8/50

C 0 8 F 2/48

【誤訳訂正書】

【提出日】平成28年3月28日 (2016.3.28)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

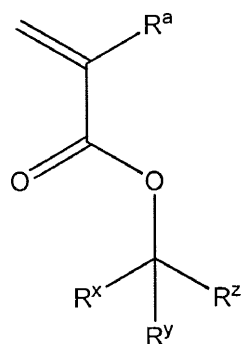
【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

式 (X X) :

【化 1】



(XX)

(式中、 R^a は H、F、 $-\text{CN}$ 、 C_{1-10} アルキルもしくは C_{1-10} フルオロアルキルであり、

(1) R^x および R^y はそれぞれ独立して置換もしくは非置換 C_{1-10} アルキル基または C_{3-10} シクロアルキル基であり、これらは一緒に環を形成し、

R^z は (i) (a) 置換もしくは非置換 C_{6-20} 芳香族含有基、(b) C_{6-20} 芳

香族含有基に結合された C_{1-6} ペルフルオロアルキルもしくは C_{3-6} ペルフルオロシクロアルキル、および (c) C_{6-20} 芳香族含有基に結合する C_{1-10} アルキレン基もしくは C_{3-10} シクロアルキレン基並びに置換基 R^x 、 R^y 、および R^z が結合された炭素原子を含む基であるか、または (ii) C_{1-6} ペルフルオロアルキルもしくは C_{3-6} ペルフルオロシクロアルキルを含む C_{6-20} 環式脂肪族含有基であり、あるいは (2) R^x および R^y はそれぞれ独立して置換もしくは非置換 C_{1-10} アルキル基または C_{3-10} シクロアルキル基であり、

R^z は置換もしくは非置換 C_{6-20} 芳香族含有基または C_{6-20} 環式脂肪族含有基であり、少なくとも 1 つの R^x および R^y は C_{1-6} ペルフルオロアルキルもしくは C_{3-6} ペルフルオロシクロアルキルを含み、さらに連結基として C_{1-20} アルキレン基を含む)

を有する電子感受性酸脱保護性モノマーとコモノマーとの重合生成物を含むコポリマー。

【請求項 2】

(1) において、 R^x 、 R^y および R^z の少なくとも 1 つが C_{1-6} ペルフルオロアルキルを含む、請求項 1 に記載のコポリマー。

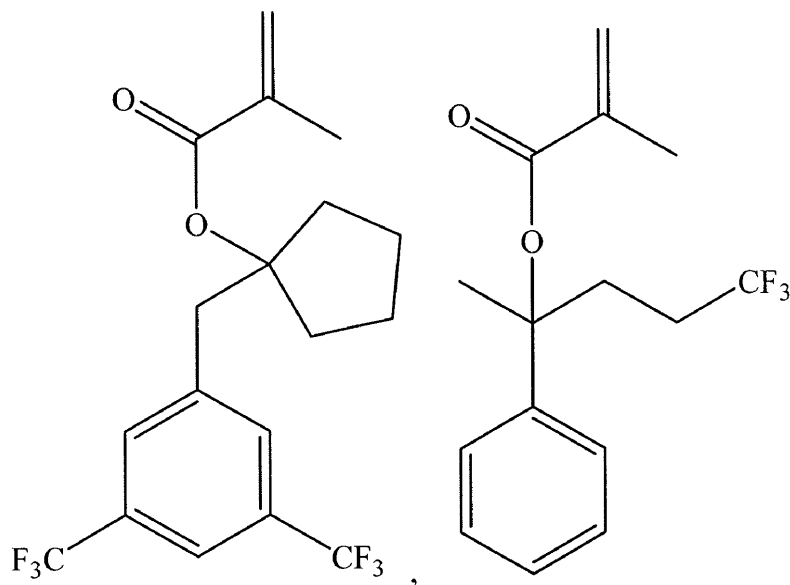
【請求項 3】

(2) において、 R^z が C_{1-6} ペルフルオロアルキルを含む置換もしくは非置換 C_{6-20} 芳香族含有基である、請求項 1 または 2 に記載のコポリマー。

【請求項 4】

前記電子感受性酸脱保護性モノマーが

【化 2】



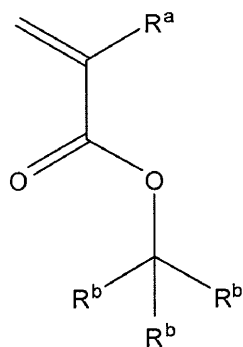
またはこれらの組み合わせを含む、請求項 1 に記載のコポリマー。

【請求項 5】

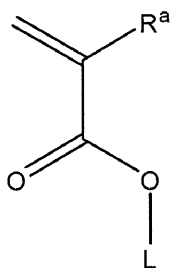
前記コモノマーが以下のモノマー：

式 (V) を有する酸脱保護性モノマー、式 (VI) のラクトン含有モノマー、式 (VII) の塩基可溶性モノマー、式 (VIII) の光酸発生モノマー、または前述のモノマーの少なくとも 1 種を含む組み合わせ：

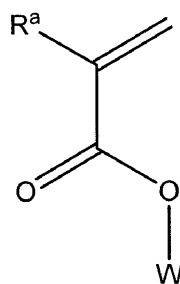
【化 3】



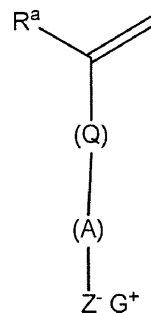
(V)



(VI)



(VII)



(VIII)

(式中、各 R^a は独立して H、F、 $-CN$ 、 C_{1-10} アルキルもしくは C_{1-10} フルオロアルキルであり、

各 R^b は独立して C_{1-20} アルキル、 C_{3-20} シクロアルキル、 C_{6-20} アリールもしくは C_{7-20} アラルキルであり、各 R^b は別々に分かれているか、または少なくとも 1 つの R^b は隣の R^b に結合されて環構造を形成しており、

L は単環式、多環式または縮合多環式 C_{4-20} ラクトン含有基であり、

W は 12 以下の pK_a を有するハロゲン化されているかもしくはハロゲン化されていない、芳香族もしくは非芳香族 C_{2-50} ヒドロキシル含有有機基であり、

Q はエステル含有またはエステル非含有で、かつフッ素化されているかまたはフッ素化されておらず、かつ C_{1-20} アルキレン、 C_{3-20} シクロアルキレン、 C_{6-20} アリーレンまたは C_{7-20} アラルキレン基であり、

A はエステル含有またはエステル非含有で、かつフッ素化されているかまたはフッ素化されておらず、かつ C_{1-20} アルキレン、 C_{3-20} シクロアルキレン、 C_{6-20} アリーレンまたは C_{7-20} アラルキレン基であり、

Z^- はスルホナートを含むアニオン性部分、スルホンアミドのアニオン、またはスルホニミドのアニオンであり、並びに

G^+ はスルホニウムもしくはヨードニウムカチオンである)

の少なくとも 1 種を含む請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載のコポリマー。

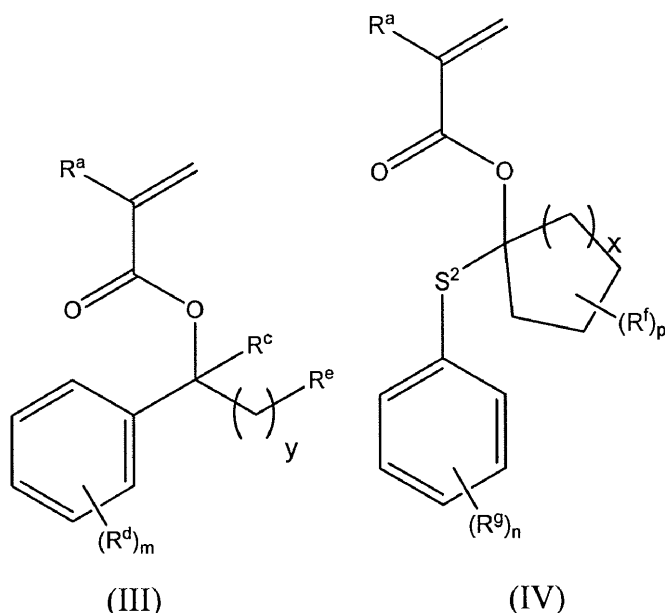
【請求項 6】

前記 コモノマー が前記式 (VIII) の光酸発生モノマーを含む、請求項 5 に記載のコポリマー。

【請求項 7】

式 (III) または (IV) :

【化 4】



(式中、各 R^a は独立して H、F、 $-CN$ 、 CH_3 、もしくは CF_3 であり、
 R^c は C_{1-10} アルキルもしくは C_{3-10} シクロアルキルであり、
 R^d 、 R^e 、 R^f 、および R^g は独立して C_{1-6} ペルフルオロアルキル、もしくは C_{3-6} ペルフルオロシクロアルキルであり、
 S^2 は C_{1-10} アルキレン基、もしくは C_{3-10} シクロアルキレン基であり、
 x は 1 ~ 20 の整数であり、 y は 1 ~ 20 の整数であり、
 m は 0 ~ 5 の整数であり、 n は 1 ~ 5 の整数であり、並びに
 p は 0 ~ $2x + 6$ の整数である)

を有する電子感受性酸脱保護性モノマーとコモノマーとの重合生成物を含むコポリマー。

【請求項 8】

請求項 1 ~ 7 のいずれかのコポリマーを含むフォトレジスト組成物。

【請求項 9】

光酸発生剤をさらに含む請求項 8 に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項 10】

(a) 基体上に請求項 8 のフォトレジスト組成物の層を適用し；(b) 前記フォトレジスト組成物層を活性化放射線にパターン様に露光し；(c) 前記露光されたフォトレジスト組成物層を現像してレジストレリーフ像を提供し；並びに (d) 前記レジストレリーフパターンを前記下地基体までエッチングする；

ことを含む電子デバイスを形成する方法。

【請求項 11】

前記放射線が極紫外線または e - ビーム放射線である請求項 10 に記載の方法。

【誤訳訂正 2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0014

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0014】

本明細書において使用される場合、「オニウム」とはヨードニウムまたはスルホニウムカチオンを言う。また、本明細書において使用される場合、「置換」とはハロゲン(すなわち、F、Cl、Br、I)、ヒドロキシ、アミノ、チオール、カルボキシル、カルボキシラート、アミド、ニトリル、チオール、スルフィド、ジスルフィド、ニトロ、 C_{1-10} アルキル、 C_{1-10} アルコキシ、 C_{6-10} アリール、 C_{6-10} アリールオキシ、 C_{7-10} アルキルアリール、 C_{7-10} アルキルアリールオキシ、または前述のものの

少なくとも１種を含む組み合わせのような置換基を含むことを意味する。本明細書において式に関して開示されたあらゆる基もしくは構造は、他に特定されない限りは、またはこの置換が結果的に得られる構造の望まれる特性に有意に悪影響を及ぼさない限りは、そのように置換されうるであろうことが理解される。本明細書において使用される場合、また「（メタ）アクリラート」はアクリラートまたはメタクリラートを意味し、他に特定されない限りはこれらのいずれかに限定されない。さらに、「フッ素化」とは、その特徴部分に組み込まれた１以上のフッ素原子を有することを意味し、例えば、 C_{1-10} フルオロアルキル基が示される場合には、その基は単一のフッ素原子、ジフルオロメチレン基、トリフルオロメチル基、これらの組み合わせを含むか、またはその基は過フッ素化基（例えば、 CF_3 、 C_2F_5 、 C_3F_7 、 C_4F_9 など）である。本明細書において使用される場合、「ペルフルオロ」は、その基における非構造的な利用可能な価数の全ての７０％超、好ましくは８０％超、より好ましくは９０％超、さらにより好ましくは９５％超がフッ素原子を有することを意味する。

【誤訳訂正３】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】００１５

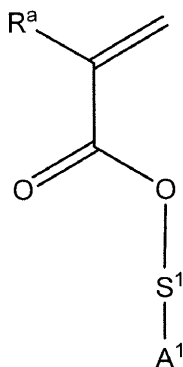
【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【００１５】

ある実施形態においては、コポリマーは、式（Ⅰ）を有する電子感受性モノマーとモノマーとの重合生成物を含む：

【化３】



(I)

式中、各 R^a は独立して H、F、 $-CN$ 、 $-C\equiv N$ 、 C_{1-10} アルキルもしくは C_{1-10} フルオロアルキルであり、 S^1 は環式または非環式、芳香族または非芳香族 C_{3-20} 第三級基であり（すなわち、第三級炭素原子が隣のエステル酸素原子に結合されている C_{3-20} 基）、並びに A^1 は置換されているかまたは置換されておらず、かつフッ素化 C_{6-20} 芳香族含有基、フッ素化 C_{6-20} 環式脂肪族含有基、または前述のものの少なくとも１種を含む組み合わせである。典型的なこの芳香族基には、フェニル、ナフチル、フルオレニル、ビフェニルが挙げられ、および典型的な環式脂肪族基には、単純なシクロアルキル基、例えば、シクロペンチルおよびシクロヘキシル、または多環式脂肪族、例えば、ノルボルネニル基およびアダマンチル基が挙げられる。好ましくは、 A^1 は置換されているかまたは置換されておらず、かつフッ素化 C_{6-20} 芳香族含有基である。

【誤訳訂正４】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】００２４

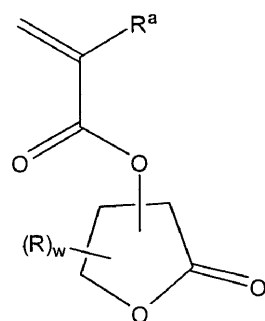
【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【００２４】

ラクトンモノマーは好ましくは式 (IX) のものである :

【化 12】



(IX)

式中、 R^a は H、F、 $-CN$ 、 C_{1-6} アルキルもしくは C_{1-6} フルオロアルキルである。 R は C_{1-10} アルキル、シクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルであり、並びに w は 0 ~ 6 の整数である。式 (IX) においては、 R はラクトン環に直接結合されるか、またはラクトン環および / または 1 以上の他の R 基に共通に結合され、かつエステル部分がラクトン環に直接結合されるかまたは間接的に R によって結合される。

【誤訳訂正 5】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0031

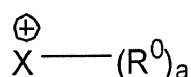
【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0031】

光酸発生モノマーはスルホニウムまたはヨードニウムカチオンを含む。好ましくは、式 (IV) においては、 G^+ は式 (XIII) のものである :

【化 18】



(XIII)

式中、 X は S または I であり、各 R^0 はハロゲン化されているかまたはハロゲン化されておらず、かつ独立して C_{1-30} アルキル基、多環式もしくは単環式 C_{3-30} シクロアルキル基、多環式もしくは単環式 C_{4-30} アリール基、または前記のもの少なくとも 1 つを含む組み合わせであるが、ただし、 X が S の場合には、 R^0 基のうちの 1 つが場合によっては単結合によって隣の 1 つの R^0 基に結合されており、 X が I の場合には a は 2 であり、 X が S の場合には a は 3 である。

【誤訳訂正 6】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0074

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0074】

しかし、表 2 に認められるように、感度の目立った向上は観察されなかった。感度の向上がないのは、ポリマー A に基づく脱離基と比較して、これら 2 種類の新たな脱離基の低い脱保護効率の結果であった。この 3 種類の脱離基の酸触媒脱保護率は様々なモノマーを 50 / 50 ジオキサン - d_6 / D_2O 混合物中に溶解させることにより、 1H NMR を用いて測定された。この混合物は攪拌されて、無色透明溶液を形成し、5 mm の NMR チューブに入れられ、そして使用するまで - 40 の冷凍庫に貯蔵された。この脱離基脱保護率は、等モル量のメタンスルホン酸をジオキサン - d_6 / D_2O 中のモノマー溶液に添加することによって室温でおよび 60 でモニターされた。バリアン 400 - MR NMR スペクトロメータのプロープが 60 に加熱され、メタンスルホン酸が NMR チューブ

のモノマー溶液に添加され、そしてそのサンプルがスペクトロメータにロードされた。この装置によってこのサンプルをロックオンするのに必要とされる時間を予測するために、サンプルがこの装置にロードされてから合計 5 分後にデータ収集が停止させられた。脱保護量はメタクリル酸のビニルピーク形成の出現によって定量化された。

【誤訳訂正 7】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 7 5

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 7 5】

表 3 は脱離基動力学的検討のまとめを示す。表 3 に示されるように、ポリマー A は最も高い脱保護効率を有する脱離基を有しているが、これは脱保護が起こるのに幾分かの加熱を必要とする評価された他の脱離基と比べて、室温で 1 0 % の脱離基脱保護の証拠があるからである。

【誤訳訂正 8】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 7 6

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 7 6】

【表 3】

脱離基	23 °C	60 °C
<u>ポリマー A の脱離基</u>	10% 脱保護	45% 脱保護
脱離基 1	0% 脱保護	10% 脱保護
脱離基 2	0% 脱保護	28% 脱保護

【誤訳訂正 9】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 7 7

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 7 7】

向上したパターン崩壊限度は、ポリマー A と比較して露光領域からのより遅い酸拡散を生じさせる追加された発色団（より低い T_g も証拠）の構造に由来する増大した疎水性の結果として起こると考えられる。